

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年2月13日(13.02.2020)



(10) 国際公開番号

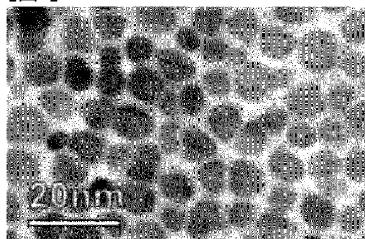
WO 2020/031460 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) *C22C 1/04* (2006.01)
GI1B 5/64 (2006.01) *C22C 19/07* (2006.01)
GI1B 5/851 (2006.01) *C22C 32/00* (2006.01)
H01F 10/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/020556
- (22) 国際出願日: 2019年5月23日(23.05.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-150675 2018年8月9日(09.08.2018) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP];
〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 増田 愛美 (MASUDA, Manami);
〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).
清水 正義 (SHIMIZU, Masayoshi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP). 岩淵靖幸 (IWABUCHI, Yasuyuki); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: アクシス国際特許業務法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: SPUTTERING TARGET, MAGNETIC FILM, AND PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット、磁性膜および垂直磁気記録媒体

【図3】



Co-Pt-Bi-TiO₂-SiO₂

(57) Abstract: This sputtering target contains at least 0.05 at% of Bi, wherein the total contained amount of metal oxides is 10-60 vol%, and the remaining portion includes Co and Pt.

(57) 要約: Bi を 0.05 at% 以上含有し、金属酸化物の合計含有量が 10 vol% ~ 60 vol% であり、残部に Co 及び Pt を含んでなるスパッタリングターゲットである。

[続葉有]

WO 2020/031460 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）